บรรณานุกรม

กมล เอี่ยมพนากิจ. (2547). *การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางหลายชั้นที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำ.* วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์. (2542). การศึกษาสภาพพื้นผิวของโพลิเมอร์ โดยใช้เทคนิค Atomic Force Microscopy. *วารสารเทคโนโลยีวัสดุ*, (15), 46-50.

จินดาวรรณ ธรรมปรีชา. (2553). *โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง.* วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์. (2544). การสร้างและศึกษา*ลักษณะของอิเลคโทรดประเภทฟิล์มบางโปร่งแสง.* วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีและวัสดุ, คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ไชยรัตน์ สุรินทร์. (2536). *การเตรียมกระจกสะท้อนคลื่นความร้อนชนิดอินเดียมออกไซด์เจือดีบุกออกไซด์โดยเทคนิคการระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอน.* วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาเทคโนโลยีและวัสดุ, คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. *รายงานการวิจัยประจำปี 2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม* (หน้า 163-166). กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

มติ ห่อประทุม. (2548). *การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคทีพ แมกนีตรอน สปัตเตอริง.* วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Auger, M. A., Va´zquez, L., Jergel, M., Sa´nchez, O., & Albella, J. M. (2004). Structure and morphology evolution of ALN films grown by DC sputtering. *Surface and Coatings Technology, 180 –181*, 140-144.

Bauer, J., Biste, L., & Bolze, D. (1977). Optical properties of aluminium nitride prepared by chemical and vapour deposition. *Phys. Status Solidi A, 39,* 173.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Brunner, D., Angerer, H., Bustarret, E., Freudenberg, F., Höpler, R., Dimitrov, R., Ambacher, O., & Stutzmann, M. (1997). Optical constants of epitaxial AlGaN films and their temperature dependence. *Journal of Applied Physics, 82*(10), 5090-5096.

Bunshah, R. F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings* (2nd ed.). New Jersey: Noyes.

Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.

Clement, M., Iborra, E., Sangrador, J., Sanz-Hervás, A., Vergara, L., & Aguilar, M. (2003). Influence of sputtering mechanisms on the preferred orientation of aluminum nitride thin films. *Journal of Applied Physics, 94*(3), 1495-1500.

Cullity, B. D. (1978). *Elements of x-ray diffraction* (2nd ed.). Addison-Wesley.

Figueroa, U., Salas, O., & Oseguera, J. (2004). Production of AlN films: ion nitriding versus PVD coating. *Thin Solid Films, 469–470*, 295-303.

_____. (2005). Deposition of AlN on Al substrates by reactive magnetron sputtering. *Surface & Coatings Technology, 200*, 1768-1776.

Haitjema, H. (1989).*Spectrally Selective Tin Oxide and Indium Oxide Coating*, Master's Degree, Engineering, Deft University of Technology, Netherlands.

Khanna, A., & Bhat, D.G. (2007). Effects of deposition parameters on the structure of AlN coatings grown by reactive magnetron sputtering. *Journal of Vacuum Science & Technology A, 25*(3), 557-565.

Khoshman, J. M., & Kordesch, M. E. (2005). Optical characterization of sputtered amorphous aluminum nitride thin films by spectroscopic ellipsometry. *Journal of Non-Crystalline Solids, 351*, 3334-3340.

Joo, H. Y., Kim, H. J., Kimb, S. J., & Kim, S.Y. (2000). The optical and structural properties of AlN thin films characterized by spectroscopic ellipsometry. *Thin Solid Films, 368*, 67-73.

Kim, D. J., Hahn, S. H., Oh, S. H., & Kim, E. J. (2002). Influence of calcinations temperature on structural and optical properties of TiO_2 thin film prepared by sol-gel dip coating. *Materials Letters, 57*, 355-360.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Kim, I. H., & Kim, S.H. (1994). Effects of ion beam irradiation on the properties and epitaxial growth of aluminium nitride film by the ion beam assisted deposition process. *Thin Solid Films, 253*, 47.

Kim, J. S., Marzouk, H. A., & Reucroft, P. J. (1995). Deposition and structural characterization of ZrO_2 and yttria-stabilized ZrO_2 films by chemical vapor deposition. *Thin Solid Films, 254,* 33.

Lee, C. K., Placido, F., Cochran S., & Kirk, K. J. (2002). Growth of sputtered AlN thin film on glass in room temperature. *IEEE Ultrasonics Symposium*, 1119-1122.

Loughin, S., & French, R. H. (1994). Properties of Group III Nitrides. In James H. Edgar (Ed.), *INSPEC* (pp. 175-189). Short Run Press: London.

Maissel, L. I., & Glang, R. (1970). *Handbook of Thin Film Technology*. New York: Mc Graw-Hill Book.

Manifacier, J.C., Gasiot, J., & Fillard, J.P. (1976). A simple method for the determination of the optical constants n, k and the thickness of a weakly absorbing thin film. *Journal of Physics K, 9,* 1002-1004.

Meng, W. J. (1994). Properties of Group III Nitrides. In James H. Edgar (Ed.), *INSPEC* (pp. 22-34). Short Run Press: London.

Moreira, M. A., Doi, I., Souza, J. F., & Diniz, J. A. (2010). Electrical characterization and morphological properties of AlNfilmsprepared by dc reactive magnetron sputtering. *Microelectronic Engineering.*

Munz, W. D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surface and Coatings Technology, 48*, 81-94.

Oliveira, I. C., Massi, M., Santos, S. G., Otani, C., Maciel, H. S., & Mansano, R. D. (2001). Dielectric characteristics of AlN films grown by d.c.-magnetron sputtering discharge. *Diamond and Related Materials, 10*, 1317-1321.

Rickerby, D. S., & Matthews, I. (1991). *Advanced Surface Coating: a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

Rohde, S. L., & Munz, W. D. (1991). *Sputter Deposition in Advanced Surface Coatings: A Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Shukla, G., & Khare, A. (2008). Dependence of N_2 pressure on the crystal structure and surface quality of AlN thin films deposited via pulsed laser deposition technique at room temperature. *Applied Surface Science, 255*, 2057-2062.

Smith, D. L. (1995). *Thin-Film Deposition : Principle And Practice.* New York: McGraw-Hill.

Sproul, W. D. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. 35th Annual Technical Conference Proceedings. *Society of Vacuum Coaters*, 236-239.

Tungasmita, S. (2001). *Growth of Wide-band Gap AlN and $(SiC)_x(AlN)_{1-x}$ Thin Films by Reactive Magnetron Sputter Deposition*, PhD.Dissertation. Linkopings University, Sweden.

Swanepoel, R. (1983). Determination of the thickness and optical constants of amorphous silicon. *Journal of Physics E, 16,* 1214-1222.

Takeuchi, M., Yamashita, H., Matsuoka, M., Anpo, M., Hirao, T., Itoh, N., & Iwamoto, N. (2000). Photocatalytic decomposition of NO under visible light irradiation on the Cr-ion-implanted TiO_2 thin film photocatalyst. *Catalysis Letters, 67*, 135-137.

Tominaga, K., Imai, H., & Sueyoshi, Y. (1993). Influence of plasma exposure in the preparation of A1N films by facing-target sputtering. *Surface and Coatings Technology, 61*, 182.

Van Vlack, L. H. (1980). *Elements of materials science and engineering* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Venkataraj, S., Severin, D., Drese, R., Koerfer, F., & Wuttig, M. (2006). Structural, optical and mechanical properties of aluminium nitride films prepared by reactive DC magnetron sputtering. *Thin Solid Films, 502*, 235-239.

Vossen, J. L., & Kerns, W. (1978). *Thin Films Processes*. New York: Academic Press.

Zhang, J. X., Cheng, H., Chen, Y. Z., Uddin, A., Yuan, S., Geng, S. J., & Zhang, S. (2005). Growth of AlN films on Si (100) and Si (111) substrates by reactive magnetron sputtering. *Surface & Coatings Technology, 198*, 68-73.

Zhao, X. T., Sakka, K., Kihara, N., Takada, Y., Arita, M., & Masuda, M. (2005). Structure and Photo-Induced Features of TiO_2 Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering. *Microelectronics Journal, 36,* 549-551.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University